

Цилиндрическая маскировка при помощи оптимизированных конечных многослойных параметров для наклонного падения

Baile Zhang and Bae-Ian Wu

Аннотация

Мы предлагаем многослойную цилиндрическую маскировочную оболочку, оптимизированную для непрямого падения путем комбинации аналитического формализма и применения генетических алгоритмов. Мы покажем, что используя только четыре однородных, анизотропных слоя с параметрами, не принимающими больших значений, рассеяние для падения под непрямым углом может быть уменьшено на два порядка. Несмотря на то, что оптимизация применялась для одного угла падения, оболочка показывает уменьшение рассеяния для широкого диапазона углов.